

研究評価委員会  
「後天的ゲノム修飾のメカニズムを活用した創薬基盤技術開発」(事後評価) 分科会  
議事要旨

日 時：平成27年6月5日(金) 10:00~17:15

場 所：WTC コンファレンスセンター Room A (世界貿易センタービル 3F)

出席者(敬称略、順不同)

<分科会委員>

分科会長	田中 博	東京医科歯科大学	名誉教授
分科会長代理	深水 昭吉	筑波大学 生命領域学際研究センター	教授
委員	大川 滋紀	日本たばこ産業株式会社 執行役員 医薬事業部医薬総合研究所	所長
委員	久保 充明	国立研究開発法人 理化学研究所 統合生命医科学研究センター	副センター長
委員	中西 理	国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 創薬支援戦略部	西日本統括部長
委員	永瀬 浩喜	千葉県がんセンター研究所	研究所長

<推進部署>

山崎 知巳	NEDO ロボット・機械システム部	統括主幹
石原 義光	NEDO ロボット・機械システム部	主幹
福井 和生	NEDO ロボット・機械システム部	主査

<実施者※メインテーブル着席者のみ>

油谷 浩幸	東京大学 先端科学技術研究センター	教授
永江 玄太	東京大学 先端科学技術研究センター	助教
川村 猛	東京大学 アイソトープ総合センター	准教授
立石 敬介	東京大学 医学部附属病院	助教
石川 俊平	東京医科歯科大学 難治疾患研究所 ゲノム応用医学研究部門	教授
木村 宏	東京工業大学 大学院生命理工学研究科	教授
舟橋 真一	株式会社未来創薬研究所 研究統括部	研究統括部長
吉田 哲郎	協和発酵キリン株式会社 研究開発本部 トランスレーショナルリサーチユニット	主任研究員
合田 哲	興和株式会社 東京創薬研究所	研究員
後藤 健吾	シスメックス株式会社 中央研究所	研究員
南 多善	エピゲノム技術研究組合	専務理事
高嶋 秀昭	エピゲノム技術研究組合	部長
眞貝 洋一	国立研究開発法人 理化学研究所 眞貝細胞記憶研究室	主任研究員

<評価事務局等>

佐藤 嘉晃	NEDO 評価部	部長
保坂 尚子	NEDO 評価部	主幹
渡邊 繁幸	NEDO 評価部	主査

## 議事次第

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
2. 分科会の設置について
3. 分科会の公開について
4. 評価の実施方法について
5. プロジェクトの概要説明
  - 5.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」
  - 5.2 「研究開発成果」及び「成果の実用化に向けての見通し及び取り組み」
  - 5.3 質疑

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明
  - 6.1 全体説明
  - 6.2 開発項目① 「後天的ゲノム修飾解析技術開発」
  - 6.3 研究開発項目② 「後天的ゲノム修飾と疾患とを関連づける基盤技術開発」
  - 6.4 研究開発項目③ 「探索的実証研究」
  - 6.5 実用化への取り組み
7. 全体を通しての質疑

(公開セッション)

8. まとめ・講評
9. 今後の予定、その他
10. 閉会

## 議事要旨

(公開セッション)

1. 開会、資料の確認
  - ・配布資料確認 (事務局)
2. 分科会の設置について
  - ・研究評価委員会分科会の設置について、資料1に基づき評価事務局より説明。
  - ・出席者の紹介 (評価事務局、推進部署)
3. 分科会の公開について
  - 評価事務局より資料2及び3に基づき説明し、議題6.「プロジェクトの詳細説明」議題7.「全体を通しての質疑」を非公開とした。
4. 評価の実施方法について
  - 評価の手順を評価事務局より資料4-1～4-5に基づき説明した。
5. プロジェクトの概要説明
  - (1) 事業の位置付け・必要性、研究開発マネジメント  
推進部署より資料5-1に基づき説明が行われた。
  - (2) 研究開発成果及び実用化に向けての見通し及び取り組みについて  
実施者より資料5-2に基づき説明が行われた。
  - (3) 質疑応答

(非公開セッション)

6. プロジェクトの詳細説明
  - 6.1 全体説明
  - 6.2 開発項目① 「後天的ゲノム修飾解析技術開発」
  - 6.3 研究開発項目② 「後天的ゲノム修飾と疾患とを関連づける基盤技術開発」
  - 6.4 研究開発項目③ 「探索的実証研究」
  - 6.5 実用化への取り組み上記の説明に対し質疑応答が行われた。
7. 全体を通しての質疑

(公開セッション)

8. まとめ・講評
9. 今後の予定、その他
10. 閉会

## 配布資料

- 資料 1 研究評価委員会分科会の設置について
- 資料 2 研究評価委員会分科会の公開について
- 資料 3 研究評価委員会分科会における秘密情報の守秘と非公開資料の取り扱いについて
- 資料 4-1 NEDOにおける研究評価について
- 資料 4-2 評価項目・評価基準
- 資料 4-3 評点法の実施について
- 資料 4-4 評価コメント及び評点票
- 資料 4-5 評価報告書の構成について
- 資料 5 プロジェクトの概要説明資料（公開）
  - 5.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」
  - 5.2 「研究開発成果」及び「実用化に向けての見通し及び取り組み」
- 資料 6 プロジェクトの詳細説明資料（非公開）
  - 6.1.全体説明
  - 6.2. 研究開発項目①「後天的ゲノム修飾解析技術開発」
    - 6.2.1 「ヒストン修飾抗体の開発と応用」
    - 6.2.2 「質量分析計によるヒストン解析技術の開発」
  - 6.3. 研究開発項目②「後天的ゲノム修飾と疾患とを関連づける基盤技術開発」
    - 6.3.1 「エピゲノムに関する病理学的評価と新規ターゲット探索」
    - 6.3.2 「DNA メチル化解析の新規技術開発と臨床応用」
  - 6.4. 研究開発項目③「探索的実証研究」
    - 「エピゲノム関連酵素のアッセイ系の構築と阻害剤探索」
  - 6.5. 実用化への取り組み
    - 6.5.1 「エピゲノム関連酵素の酵素学的解析と阻害薬探索」
    - 6.5.2 「核酸医薬標的としての腫瘍特異的非コード RNA の探索」
- 資料 7 事業原簿（公開）
- 資料 8 今後の予定
- 参考資料 1 NEDO 技術委員・技術委員会等規程
- 参考資料 2 技術評価実施規程

以上